# 一种考虑空间关联工艺偏差的统计静态时序分析方法

喻 伟<sup>①2</sup> 杨海钢<sup>\*①</sup> 刘 洋<sup>①</sup> 黄 娟<sup>①</sup> 蔡博睿<sup>①</sup> 陈 锐<sup>①2</sup> <sup>①</sup>(中国科学院电子学研究所 北京 100190) <sup>2®</sup>(中国科学院大学 北京 100086)

**摘 要:**为了准确评估工艺参数偏差对电路延时的影响,该文提出一种考虑空间关联工艺偏差的统计静态时序分析 方法。该方法采用一种考虑非高斯分布工艺参数的二阶延时模型,通过引入临时变量,将2维非线性模型降阶为1 维线性模型;再通过计算到达时间的紧密度概率、均值、二阶矩、方差及敏感度系数,完成了非线性非高斯延时表 达式的求和、求极大值操作。经 ISCAS89 电路集测试表明,与蒙特卡洛仿真(MC)相比,该方法对应延时分布的均 值、标准差、5%延时点及95%延时点的平均相对误差分别为0.81%,-0.72%,2.23%及-0.05%,而运行时间仅为蒙 特卡洛仿真的0.21%,证明该方法具有较高的准确度和较快的运行速度。

 关键词:集成电路;统计静态时序分析;空间关联;非高斯非线性;工艺偏差;延时模型

 中图分类号:TN402
 文献标识码:A
 文章编号:1009-5896(2015)02-0468-09

 DOI: 10.11999/JEIT140295

# A Statistical Static Timing Analysis Incorporating Process Variations with Spatial Correlations

Yu Wei $^{\bigcirc}$ 

Yang Hai-gang<sup>①</sup> Liu Yang<sup>①</sup> Huang Juan<sup>①</sup> Cai Bo-rui<sup>①</sup> Chen Rui<sup>①②</sup> <sup>①</sup>(Institute of Electronics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China) <sup>③</sup>(University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100086, China)

Abstract: To evaluate effects of process variations on circuit delay accurately, this study proposes a Statistical Static Timing Analysis (SSTA) which incorporates process variations with spatial correlations. The algorithm applies a second order delay model that taking into account the non-Gaussian parameters - by inducting the notion of 'conditional variables', the 2D non-linear delay model is translated into 1D linear one; and by computing the tightness probability, mean, variance, second-order moment and sensitivity coefficients of the circuit arrival time, the sum and max operations of non-linear and non-Gaussian delay expressions are implemented. For the ISCAS89 benchmark circuits, as compared to Monte Carlo (MC) simulation, the average errors of 0.81%, -0.72%, 2.23% and -0.05%, in the mean, variance, 5% and 95% quantile points of the circuit delay are obtained respectively for the proposed method. The runtime of the proposed method is about 0.21% of the value of Monte Carlo simulation. The experimental results prove that the high accuracy of the SSTA is reliable.

**Key words**: Integrated Circuit (IC); Statistical Static Timing Analysis (SSTA); Spatial correlations; Nongaussianity and non-linearity; Process variations; Delay model

# 1 引言

随着集成电路工艺的特征尺寸缩小到纳米尺度,工艺参数偏差的影响变得越来越显著。这些工 艺偏差导致了芯片电气参数随机变化,并给电路的 时序评估带来极大挑战。为了解决工艺偏差带来的 影响,传统的静态时序分析(Static Timing Analysis, STA),通过在不同的工艺角下执行时序裕量检查, 来实现电路的时序评估。然而,随着工艺参数偏差

2014-03-06 收到, 2014-06-09 改回

国家科技重大专项 (2013ZX03006004) 和国家自然科学基金 (61106033)资助课题

\*通信作者:杨海钢 yanghg@mail.ie.ac.cn

源的增多,需要考虑的工艺角数量随之增多,基于 多工艺角的 STA 变得越来越费时;而且由于片内逻 辑门不同位置的工艺参数存在空间关联,多工艺角 STA 也没有考虑到这些关联统计信息,从而使得评 估结果过于悲观。在利用这些悲观结果指导时序优 化时,将会造成严重的资源浪费,并影响到电路功 耗、面积等其他性能参数的评估。

因此,与传统多工艺角 STA 相比,统计静态时 序分析(Statistical Static Timing Analysis, SSTA) 显得更为可靠。SSTA 的处理对象为延时的概率分 布函数(Probability Distribution Function, PDF)和 累计分布函数(Cumulative Distribution Function, CDF),换句话说,SSTA 利用工艺参数偏差的统计 信息来评估最终延时的统计分布。尽管影响 SSTA 延时变化的因素很多<sup>[1-9]</sup>,但随着工艺尺寸的不断 缩小,在深亚微米尺度下工艺参数偏差仍然是影响 延时变化的最大因素。考虑工艺参数偏差的 SSTA 方法虽不是最新的研究热点,但在算法分析方面还 是为国内的研究开展提供了方向;而且从目前 SSTA EDA 工具的开发经验来看,考虑工艺参数偏差的 SSTA 方法显得更切实际。

考虑工艺偏差的 SSTA 方法大致可以分为两 类:一类是基于路径的方法<sup>[6]</sup>,这类方法通常先利用 传统的 STA 方法找到一定数量的关键路径, 然后再 采用基于路径的分析流程来运行参数化 SSTA,由 于需要遍历一定数量的路径,其时间代价往往较高; 另一类是基于块的方法<sup>[7-9]</sup>,这类方法通常先采用 基于项目评估技术<sup>[10]</sup>(Program Evaluation and Review Technique, PERT)的拓扑技术遍历时序图, 然后再完成从输入到输出的延时分布传递,由于不 需逐个遍历路径,其时间代价相对较小。从区分工 艺参数分布和延时依赖关系的角度看,这些基于块 的 SSTA 方法大致又可以分为 4 类: (1)线性高斯 SSTA, 在这类方法中, 研究人员将工艺参数假设为 高斯分布,在利用主元分析(Principle Component Analysis, PCA)技术<sup>[11]</sup>把那些空间关联高斯变量转 换为彼此独立高斯变量后,将延时表示为独立高斯 变量的一阶线性表达式,如文献[7],这类方法忽略 了工艺参数的非高斯分布形式和延时变量的非线性 表示方式,因而是一种不完备的 SSTA 分析方法; (2)非线性高斯 SSTA: 在这类方法中,研究人员仍 将工艺参数假设为高斯分布,在利用 PCA 技术进行 变量转换后,将延时表示为独立高斯变量的非线性 表达式,特别是二阶表达式,如文献[8],由于这类 方法同样忽略了工艺参数的非高斯分布形式,所以 也是一种不完备的 SSTA 分析方法; (3)线性非高斯 SSTA: 在这类方法中,研究人员不再将工艺参数局 限于高斯分布,可以是任意非高斯分布,在利用独 立元分析(Independent Component Analysis, ICA) 技术[12]把那些空间关联非高斯变量转换为彼此独立 非高斯变量后,将延时表示为工艺参数的一阶线性 表达式,如文献[9]。由于这类方法也忽略了延时变 量的非线性表示方式,同样是一种不完备的 SSTA 分析方法; (4)非线性非高斯 SSTA: 这类方法是其 他3类方法的综合,工艺参数既能满足任意分布, 延时又可以是工艺参数的非线性表达式,因此是一 种更通用更完备的方法。

基于以上分析,本文提出了一种基于块的考虑 空间关联非高斯分布工艺偏差的非线性统计静态时 序分析方法。这种方法首先假设了芯片内不同位置 的工艺参数存在空间关联性,使其更加符合实际情 况;然后将工艺参数假设为高斯分布和非高斯分布 并存的情形,并将延时表示为工艺参数的二阶表达 式;最后利用降阶方法将非线性延时模型降阶为线 性延时模型,通过计算延时的紧密度概率、均值、 二阶矩、方差及敏感度系数,完成非线性非高斯延 时表达式的求和及求极大值操作。本文方法避免了 前文方法中工艺参数的不完备表达,改进了延时变 量的建模方法,并提高了 SSTA 分析的完整性和准 确性。

# 2 工艺参数的空间关联与电路延时的非高 斯非线性属性

# 2.1 SSTA 中的工艺参数空间关联

为了探究芯片内逻辑门不同位置工艺参数之间 的空间关联性,本文借鉴了文献[7]提出的方格树模 型,如图1所示。在此模型中,芯片被抽象为一个 多层次的方格树,在树的第*i*层,芯片被划分为 2<sup>*i*</sup>×2<sup>*i*</sup>个方格。这种树形结构在不同层次的方格间 形成一种等级关系,若较高层的一个方格和较低层 的某些方格共享面积,那么较高层的这个方格就被 称为父方格,较低层的方格则被称为子方格。对于 同一个方格内的不同逻辑门,它们具有相同的工艺 参数敏感度,如顶层内的所有逻辑门就具有相同的 工艺参数敏感度;对于不同方格内的不同逻辑门, 其工艺参数的空间关联性由它们的父方格所决定。





在每一个方格内,本文用一个单独的随机变量 表示一个工艺参数,最底层方格内的逻辑门工艺参 数是由其自身方格内的工艺参数和所有父方格内的 工艺参数共同决定的。例如在图 1(a)中,方格[0,1] 为[1,1]的父方格,方格[1,1]为[2,1]的父方格,那么方 格[2,1]内的逻辑门沟道长度 *L*(2,1)就可以表示为如 式(1)与物理位置相关的参数化表达式:

$$L(2,1) = L_0 + \Delta L_{2,1} + \Delta L_{1,1} + \Delta L_{0,1}$$
(1)

其中, $L_0$ 为沟道长度本征值, $\Delta L_{2,1}$ , $\Delta L_{1,1}$ , $\Delta L_{1,0}$ 分别表示方格[2,1],[1,1],[1,0]内的沟道长度偏差。

不同方格内工艺参数的空间关联程度是由其共同的父方格所决定的,例如方格[2,1],[2,2]及[2,16]内的逻辑门沟道长度分别可以表示为

$$L(2,1) = L_0 + \Delta L_{2,1} + \Delta L_{1,1} + \Delta L_{0,1}$$

$$L(2,2) = L_0 + \Delta L_{2,2} + \Delta L_{1,1} + \Delta L_{0,1}$$

$$L(2,16) = L_0 + \Delta L_{2,16} + \Delta L_{1,4} + \Delta L_{0,1}$$
(2)

在式(2)中,方格[2,1]和[2,2]共享两个父方格 ( $\Delta L_{1,1}, \Delta L_{0,1}$ ),而方格[2,1]和[2,16]只共享一个父方 格( $\Delta L_{0,1}$ )。因此,与方格[2,1]和[2,16]对应空间关联 程度相比,方格[2,1]和[2,2]之间的工艺参数空间关联 程度更高,这也表明两个逻辑门离得越近,其工艺 参数空间关联程度越高,逻辑门的工艺参数变化越 具有相似性。

另外需要指出的是:(1)空间关联仅局限于同一种工艺参数,不同的工艺参数之间彼此独立,例如 方格[2,1]内的沟道长度仅与其它方格内的沟道长度 存在关联,而和其它诸如栅氧化层厚度、半导体掺 杂浓度等工艺参数没有关系;(2)对于一个3层的方 格树,在表示最底层两个方格内任一工艺参数的关 联关系时,需要一个16×16的协方差矩阵;(3)对于 顶层方格,由于它是所有其它方格的父方格,所以 它可以用来表示片外工艺参数偏差,而片内工艺参 数偏差则可由其它层次的方格来表示,这样本文方 格模型就可以表示所有的片内偏差和片外偏差。

#### 2.2 SSTA 中的非高斯非线性

随着工艺尺寸的减小,电路延时呈现出越来越 多的非高斯属性。实际分析时,一些工艺参数往往 会极大地偏离高斯分布,如互连线的金属宽度会呈 现出非对称的概率分布,半导体掺杂浓度会呈现出 泊松分布等;同时由于片内空间邻近效应的存在, 这些非高斯分布工艺参数彼此空间关联,若依据传 统的 SSTA 方法将这些工艺参数表示为高斯分布, 则很可能会导致电路延时的 PDF 严重偏离实际情 形。

随着工艺尺寸的减小,电路延时也呈现出越来 越多的非线性属性。因为逻辑门延时和互连线延时 往往是工艺参数的参数化表达式,当工艺参数偏差 较小时,一阶泰勒展开式足够精确;然而随着工艺 参数偏差的增大,一阶线性表达式已不再适用,延 时表达更多地呈现非线性特征。另外,对于基于块 的 SSTA 方法,在时序图上传递延时分布时,执行 了两个基本操作:求和、求极大值。求和一般适用 于单输入逻辑单元,如反相器、缓冲器和互连线等, 若输入信号到达时间和单输入逻辑单元延时都服从 高斯分布,那么输出信号到达时间也是一个高斯分 布,所以求和操作是一个线性操作;求极大值一般 适用于多输入逻辑单元,如与门、或门等,即使两 个随机变量 A, B 相互独立且满足高斯分布,其极大 值仍为非高斯分布,所以求极大值操作是一个非线 性操作。同时还需要指出的是,在求解延时偏斜时, 需要计算其三阶矩,如果延时为一阶线性表达,那 么其三阶矩则为零,这与实际非高斯分布随机变量 对应延时偏斜非零的事实相矛盾,所以在计算延时 偏斜时,也有必要将延时表示为非线性表达式,如 二阶表达式等。

针对 SSTA 中工艺参数的空间关联性及延时表达的非高斯非线性,本文提出一种改进的空间关联统计静态时序分析(Correlated Statistical Static Timing Analysis, CSSTA)方法,从而将这两个问题考虑进来。

## **3** CSSTA 算法流程

本文 CSSTA 算法流程如图 2 所示。首先根据 前文的非高斯非线性分析,将影响延时分布的工艺 参数划分为高斯参数和非高斯参数两部分,将空间 关联的高斯分布(非高斯分布)工艺参数转化为一组 彼此独立的高斯分布(非高斯分布)随机变量,并将 延时表示为这组独立随机变量的二阶非线性模型: 然后基于二阶非高斯非线性模型,采用基于 PERT 的延时分布拓扑传递方法,针对时序图上的每一个 节点执行求和操作(sum)和求极大值操作(max),以 期获得节点到达时间的参数化表达式,并通过计算 节点到达时间的紧密度概率、均值、二阶矩、方差 及敏感度系数,得到参数化延时表达式的近似拟合: 最后根据参数化延时表达式的具体形式,通过匹配 工艺参数的 k 阶矩,得到经由 PCA (ICA)转化后的 独立随机变量的矩,并根据这些独立随机变量的矩 和延时变量非线性模型,得到延时变量的矩,从而 利用延时变量的矩和概率提取流程算法,生成延时 变量的 PDF。

#### 3.1 基于工艺参数偏差的延时建模

为了描述工艺参数偏差对电路延时的非线性影



#### 图 2 CSSTA 算法流程图

响,本文采用基于截断的泰勒展开多项式,将一阶 线性表达式扩展为二阶延时模型:

$$D = d_0 + \sum_{i=1}^{n} p'_i x_i + \sum_{j=1}^{m} q'_j y_j + \sum_{i=1}^{n} p''_i x_i^2 + \sum_{i=1}^{m} q''_i y_j^2 + e \cdot z$$
(3)

其中, D 为对应逻辑门延时或输入端到达时间的随 机变量,  $d_0$  为 D 的本征值,  $x_i$  为空间关联工艺参数 高斯变量,  $y_j$  为空间关联工艺参数非高斯变量, z 为空间独立工艺参数随机变量;  $p'_i$ ,  $p''_i$  分别为第 i 个 高斯分布工艺参数的一阶、二阶敏感度系数,  $q'_j$ ,  $q''_j$ 分别为第 j 个非高斯分布工艺参数的一阶、二阶敏 感度系数, e 为随机变量 z 的敏感度系数; n 和 m分别为空间关联高斯分布和非高斯分布工艺参数的 个数。

考虑到正交变换的处理流程,将 D 表示为工艺 参数的向量表达式:

 $D = d_0 + p'x + q'y + x^T p''x + y^T q''y + e \cdot z$  (4) 其中  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 为空间关联高斯分布工艺参 数向量,  $y = (y_1, y_2, \dots, y_m)^T$ 为空间关联非高斯分布 工艺参数向量;  $p' = (p'_1, p'_2, \dots, p'_n)$ 为一阶项 x 的敏 感度系数向量,  $q' = (q'_1, q'_2, \dots, q'_m)$ 为一阶项 y的敏感 度系数向量,  $p'' \to n \times n$  对角矩阵,其对角线系数  $p''_i$ 为二阶项 x的敏感度系数,  $q'' \to m \times m$  对角矩阵, 其对角线系数  $q''_i$ 为二阶项 y的敏感度系数。

接着,运用 PCA (ICA)技术,将空间关联的高 斯分布工艺参数向量 *x*(空间关联的非高斯分布工艺 参数向量 *y*)转换为彼此独立的高斯分布工艺参数向 量 *X*(彼此独立的非高斯分布工艺参数向量 *Y*),将 *D*进一步表示为

$$\boldsymbol{D} = d_0 + \boldsymbol{P}'\boldsymbol{X} + \boldsymbol{Q}'\boldsymbol{Y} + \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}''\boldsymbol{X}$$

$$+ \mathbf{Y}^{\mathrm{T}} \mathbf{Q}^{\prime\prime} \mathbf{Y} + \mathbf{E} \cdot \mathbf{Z}$$
 (5)

其中, **X**为转换后的高斯分布工艺参数向量, **Y**为 转换后的非高斯分布工艺参数向量;  $P' = (P'_1, P'_2, ..., P'_n)$ 为一阶项 **X**的敏感度系数向量,  $Q' = (Q'_1, Q'_2, ..., Q'_m)$ 为一阶项 **Y**的敏感度系数向量, P''为 $n \times n$ 对角矩阵,其对角线系数  $p''_i$ 为二阶项 **X**的敏感度系 数, Q''为 $m \times m$ 对角矩阵,其对角线系数  $Q''_j$ 为二 阶项 **Y**的敏感度系数。需要注意的是,对于空间独 立随机变量 *z*,根据中心极限定理(不同独立随机变 量的叠加满足高斯分布),可以将 *z*转换为一个均值 为 0,方差为 1 的标准正态分布变量 *Z*,*Z* ~ *N*(0,1), 同时所有的  $X_i$ ,  $Y_j$ 也满足均值为 0,  $-1 \le X_i \le 1$ ,  $-1 \le Y_i \le 1$ 。

## 3.2 非线性非高斯延时的统计操作

参数化基于块的 SSTA 方法通常将电路抽象为

一个统计时序图G = (N, E, n<sub>s</sub>, n<sub>f</sub>)。其中, N 为节点 集合, E 为边集合, n<sub>s</sub>为源节点, n<sub>f</sub>为终节点。从 源节点到终节点传递延时分布时,通过执行求和或 求极大值操作,就可以依次求出节点到达时间的概 率分布(参数化表达式),如图3所示。



图 3 统计时序图中求和、求极大值操作及延时分布传递

**3.2.1 求和**因为求和操作是一个线性操作,所以求和结果应该与输入到达时间及门延时具有相同的表达式。参考式(5),考虑两个非线性非高斯延时表达式 *A* 和 *B*:

$$A = d_{0A} + \sum_{i=1}^{n} (P'_{iA}X_i + P''_{iA}X_i^2) + \sum_{j=1}^{m} (Q'_{jA}Y_j + Q''_{jA}Y_j^2) + E_A \cdot Z B = d_{0B} + \sum_{i=1}^{n} (P'_{iB}X_i + P''_{iB}X_i^2) + \sum_{j=1}^{m} (Q'_{jB}Y_j + Q''_{jB}Y_j^2) + E_B \cdot Z$$
(6)

求和结果 C = A + B 可以表示为  $C = \alpha A + \beta B + \gamma = \mu_C + \sum_{i=1}^n (f'_i X_i + f''_i X_i^2)$  $+ \sum_{j=1}^m (g'_j Y_j + g''_j Y_j^2) + E_C Z_C$  (7)

其中

$$\begin{array}{l}
f_{i}^{'} = \alpha P_{iA}^{'} + \beta P_{iB}^{'} \\
f_{i}^{''} = \alpha P_{iA}^{''} + \beta P_{iB}^{''} \\
g_{j}^{'} = \alpha Q_{jA}^{'} + \beta Q_{jB}^{'} \\
g_{j}^{''} = \alpha Q_{jA}^{''} + \beta Q_{jB}^{''} \\
E_{C} = \sqrt{E_{A}^{2} + E_{B}^{2}} \\
\mu_{C} = \alpha d_{0A} + \beta d_{0B} + \gamma
\end{array}$$
(8)

**3.2.2 求极大值** 因为求极大值是一个非线性操作, 所以为了获取 max(*A*,*B*)的近似估计,本文借鉴了线 性高斯 SSTA<sup>[7]</sup>中的处理方法。本文算法通过引入临 时变量,将 2 维非线性模型降阶为 1 维线性模型; 然后在此 1 维线性模型的基础上,通过计算 max(*A*, *B*)的紧密度概率、均值、二阶矩及方差,获得了 max(*A*,*B*)的近似表达。

观察式(6),将其中的随机变量表达式分解为 4

部分:线性高斯部分  $\sum_{i=1}^{n} P'_{i} X_{iL}$ 、非线性高斯部分  $\sum_{i=1}^{n} P''_{i} X^{2}_{iN}$ 、线性非高斯部分  $\sum_{j=1}^{m} Q'_{j} Y_{jL}$ 及非线性 非高斯部分  $\sum_{j=1}^{m} Q''_{j} Y^{2}_{jN}$ ; 令  $X_{iL}$  为线性高斯随机变 量, $X_{iN}$  为非线性高斯随机变量, $Y_{jL}$  为线性非高斯 随机变量, $Y_{jN}$  为非线性非高斯随机变量,则式(5) 可表示为

$$\boldsymbol{D} = d_0 + \sum_{i=1}^n P'_i X_{iL} + h(X_{iN}, Y_{jL}, Y_{jN}) + E \cdot Z \quad (9)$$

其中,  $h(X_{iN}, Y_{jL}, Y_{jN})$ 为一个临时变量,它代表了线性高斯部分以外的随机变量表达式。

$$h(X_{\rm iN}, Y_{\rm jL}, Y_{\rm jN}) = \sum_{i=1}^{n} P_i^{''} X_i^2 + \sum_{j=1}^{m} (Q_j^{'} Y_{\rm jL} + Q_j^{''} Y_{\rm jN}^2) \quad (10)$$

假设非线性高斯部分、线性非高斯部分及非线性非高斯部分是固定的,那么临时变量 $h(X_{iN}, Y_{jL}, Y_{jN})$ 也将固定,将 $h(X_{iN}, Y_{jL}, Y_{jN})$ 和 $d_0$ 当作一个整体,重写式(9)为

$$\boldsymbol{D} = [d_0 + h(X_{\rm iN}, Y_{\rm jL}, Y_{\rm jN})] + \sum_{i=1}^n P_i^{'} X_{\rm iL} + E \cdot Z \quad (11)$$

式(11)可以看作为一个本征值为 $d_0$  +  $h(X_{iN}, Y_{jL}, Y_{jN})$ 的一阶线性表达式,再次考虑两个用式(11)表示的A和B:

$$A = d_{0A} + h_A(X_{iN}, Y_{jL}, Y_{jN}) + \sum_{i=1}^n P'_{iA}X_{iL} + E_A \cdot Z$$
  
$$B = d_{0B} + h_B(X_{iN}, Y_{jL}, Y_{jN}) + \sum_{i=1}^n P'_{iB}X_{iL} + E_B \cdot Z$$
  
(12)

于是, 当 $X_{iN}$ ,  $Y_{jL}$ 及 $Y_{jN}$ 固定时, max(A,B)的临 时紧密度概率 $T_{A,cond}$ 、临时均值 $\mu_{C,cond}$ 及临时二阶矩  $m_{2C,cond}$ 就可以表示为 $X_{iN}$ ,  $Y_{iL}$ 及 $Y_{iN}$ 的函数。

$$T_{A,\text{cond}}(X_{iN}, Y_{jL}, Y_{jN}) = p(A > B \mid X_{iN}, Y_{jL}, Y_{jN})$$

$$\mu_{C,\text{cond}}(X_{iN}, Y_{jL}, Y_{jN}) = E[\max(A, B) \mid X_{iN}, Y_{jL}, Y_{jN}]$$

$$m_{2C,\text{cond}}(X_{iN}, Y_{jL}, Y_{jN}) = E[(\max(A, B))^2 \mid X_{iN}, Y_{jL}, Y_{jN}]$$
(13)

同时,由于 X<sub>iL</sub> 的概率分布可以简单地等效为 X<sub>iN</sub>,Y<sub>iL</sub> 及 Y<sub>iN</sub> 的联合概率分布:

$$p(X_{iL} \mid X_{iN}, Y_{jL}, Y_{jN}) = p(X_{iN}, Y_{jL}, Y_{jN})$$
(14)

在用  $d_{0A} + h_A(X_{iN}, Y_{jL}, Y_{jN})$  和  $d_{0B} + h_B(X_{iN}, Y_{jL}, Y_{jN})$  替换掉线性高斯延时表达式中的  $d_{0A}$  和  $d_{0B}$  后, 将临时紧密度概率、临时均值及临时二阶矩在联合 概率分布的随机变量参数空间内积分,就可以计算 出 max(*A*,*B*)的正式紧密度概率  $T_A$ 、正式均值  $\mu_C$ 、 正式二阶矩  $m_{2C}$  及正式方差  $\sigma_C^2$ 。

$$T_{A} = \iiint T_{A,\text{cond}}(X_{\text{iN}}, Y_{\text{jL}}, Y_{\text{jN}})p(X_{\text{iN}}, Y_{\text{jL}}, Y_{\text{jN}})$$

$$\cdot dX_{\text{iN}}Y_{\text{jL}}Y_{\text{jN}}$$

$$\mu_{C} = \iiint \mu_{C,\text{cond}}(X_{\text{iN}}, Y_{\text{jL}}, Y_{\text{jN}})p(X_{\text{iN}}, Y_{\text{jL}}, Y_{\text{jN}})$$

$$\cdot dX_{\text{iN}}Y_{\text{jL}}Y_{\text{jN}}$$

$$m_{2C} = \iiint m_{2C,\text{cond}}(X_{\text{iN}}, Y_{\text{jL}}, Y_{\text{jN}})p(X_{\text{iN}}, Y_{\text{jL}}, Y_{\text{jN}})$$

$$\cdot dX_{\text{iN}}Y_{\text{jL}}Y_{\text{jN}}$$

$$\sigma_{C}^{2} = E[\max(A, B)^{2}] - (E[\max(A, B)])^{2} = m_{2C} - \mu_{C}^{2}$$
(15)

在获得 max(*A*,*B*)的紧密度概率、均值及二阶矩 之后,就可以利用  $C_{appr}$  来近似估计 max(*A*,*B*)。因 为系数  $P'_{iC} \stackrel{}{=} P'_{iA} \stackrel{}{=} n P'_{iB}$ 的线性组合,系数  $h_C \stackrel{}{=} h_A n$  $h_B$ 的线性组合,所以可以将  $C_{appr}$  视为一阶线性情形  $C_{appr} = d_{0C} + h_C(X_{iN}, Y_{jL}, Y_{jN}) + \sum_{i=1}^{n} P'_{iC} X_{iL} + E_C \cdot Z$  (16) 令  $C_{appr}$ 的方差为 var( $C_{appr}$ ),则  $C_{appr}$ 的相关参 数为

$$d_{0C} = E[\max(A, B)] = \mu_{C}$$

$$h_{C}(X_{iN}, Y_{jL}, Y_{jN}) = T_{A}h_{A}(X_{iN}, Y_{jL}, Y_{jN})$$

$$+ (1 - T_{A})h_{B}(X_{iN}, Y_{jL}, Y_{jN})$$

$$P'_{iC} = T_{A}P'_{iA} + (1 - T_{A})P'_{iB}, \quad 1 < i < n$$

$$E_{C} = \{E_{C} \mid \sigma_{C}^{2} = \operatorname{var}(C_{appr})\}$$
(17)

为了突出本文非线性非高斯延时表达式与传统 线性高斯延时表达式求极大值操作的对比结果,图 4 给出了包含两个随机变量的 max(*A*,*B*)近似示意 图,其中图 4(a)为线性高斯情形,图 4(b)为本文非 线性非高斯情形。在图 4(b)中,虚曲线分别为非线 性表达式 *A*, *B*,弯折实曲线为准确的 max(*A*,*B*), 光滑实曲线为近似的*C*<sub>appr</sub>。可以看出,光滑实曲线 *C*<sub>appr</sub>和弯折实曲线 max(*A*,*B*)具有较高的拟合度, 证明本文参数化表达式的近似拟合结果具有一定的 合理性。若把各个随机变量从 1 维扩展到多维,这 种图示方法仍然适用,只不过图中曲线变成了曲面。

## 3.3 基于矩匹配的延时评估

在计算延时或到达时间的 PDF(CDF)时,本文 采用了文献[13]提出的概率提取流程算法 (Asymptotic Probability Extraction, APEX)。算法 首先将一个随机变量的二阶矩作为输入,采用渐进 波形评估技术来匹配这个随机变量的 2*M* 阶矩,从 而生成一个 *M* 阶的线性无关系统;接着利用这个 *M* 阶线性无关系统的冲激响应(阶跃响应)来近似拟合 随机变量的 PDF (CDF)。



图 4 max(A,B)的准确表达与近似表达示意图

本文以一个简单的例子解释基于矩匹配的 PDF 评估方法。假设 w, l 为空间关联高斯分布(非 高斯分布)随机变量,且 w 和 l 相互独立。令 $\overline{D} =$  $p \cdot w + q \cdot l$ ,其中 $\overline{D} = D - \mu$ ,经 PCA, ICA 转换后,  $\overline{D} = P \cdot W + Q \cdot L$ ,其中 W, L 为高斯分布(非高斯 分布)彼此独立随机变量,那么 $\overline{D}$ 的k阶矩就可以用 式(18)的二项展开式表示。

$$m_k\left[\overline{D}\right] = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} P^i Q^{k-i} m_i(W) m_{k-i}(L)$$
(18)

因为 W 和 L的所有 i阶矩可按文献[9]所提方法 求得,所以根据式(18)计算得到 $\overline{D}$ 的 2M 矩后,利 用 M 阶线性无关系统的冲激响应即可近似拟合 $\overline{D}$ 的实际 PDF。

$$f_{\overline{D}}(\overline{d}) = \begin{cases} \sum_{i=1}^{M} r_i \cdot e^{\rho_i \cdot \overline{d}}, & \overline{d} > 0\\ 0, & \overline{d} < 0 \end{cases}$$
(19)

式(19)中, $r_i$ , $\rho_i$ 为 *M* 阶线性无关系统的极数。对于式(5)所示延时表达,其共有2m + 2n + 2项,只要延时表达式中这2m + 2n + 2个随机变量是统计独立的,那么就可以应用以上方法评估延时变量的PDF。

#### 4 本文算法复杂度分析

如果将 PCA 正交转换、ICA 矩阵生成及独立

随机变量矩计算过程等当作一次性的预处理,那么 本文 SSTA 流程的计算复杂度仅包含了时序图拓扑 遍历中的求和及求极大值操作。若非高斯独立随机 变量的数量为 n,高斯独立随机变量的数量为 m,则求和操作的时间复杂度为O(n+m);同时,若用 于评估各个随机变量的矩的阶数为 2M,则求极大值 操作的时间复杂度即为O(M(n+m))。实际操作中, 因为 M是有上界的,所以求极大值操作的时间复杂 度也可以看作为O(n+m)。对于一个含有 G 个逻辑 门的应用电路,因为其各个门的扇入个数有界,则 基本操作的总体时间复杂度就为 $O((n+m) \cdot G)$ 。假 设延时建模时片内方格数量为 g,因为 m, n与方格 数量 g成正比,O(m) = O(n) = O(m+n) = O(g),那 么本文基于空间关联工艺偏差的 SSTA 总体时间复 杂度就可以表示为 $O(g \cdot G)$ 。

### 5 实验结果

基于美国明尼苏达州立大学的 MinnSSTA 开源 框架<sup>[7]</sup>,本文在 Windows 平台下采用 C++语言实现 了所提算法。实验的硬件平台为: CPU 3.6 GHz, 内存 1.0 GB。算法所用测试电路来自于 ISCAS89 测试集<sup>[14]</sup>,之所以选择 ISCAS89,是因为: (1)学术 界广泛承认并使用; (2)ISCAS89 测试集中两个锁存 器之间的组合模块非常有利于本文 CSSTA 的基本 操作和延时评估。本文利用文献[11]提出的方法实现 了高斯变量的 PCA 转换,利用 FastICA 软件包<sup>[15]</sup> 实现了非高斯变量的 ICA 转换,同时对每个工艺参 数,生成 5000 个随机样本。

在本文实验中,工艺参数既有空间关联也有空间独立,既有高斯分布也有非高斯分布。对于逻辑门工艺参数,只考虑逻辑门长度 $L_g$ ,逻辑门宽度 $W_g$ , 栅氧化层厚度 $T_{ox}$ 及半导体掺杂浓度 $N_a$ ;对于互连线工艺参数,在每一金属层 l,只考虑金属互连线宽度 $W_{int,l}$ ,金属互连线厚度 $T_{int,l}$ 及金属高度 $H_{ILD,l}$ ; 令 $L_g$ , $W_g$ , $T_{ox}$ , $W_{int,l}$ , $T_{int,l}$ 及 $H_{ILD,l}$ 为空间关联的工艺参数,令 $N_a$ 为空间独立的工艺参数。基于方格模型,本文将各个方格内逻辑门的 $L_g$ , $W_g$ 及 $T_{ox}$ 表示为高斯分布,其参数取值范围为[ $\mu - 3 \cdot \sigma, \mu + 3 \cdot \sigma$ ];将各个方格内互连线的 $W_{int,l}$ , $T_{int,l}$ 及 $H_{ILD,l}$ 表示为非高斯分布(如均匀分布),其参数取值范围为[ $\mu - \sqrt{3}$ 

表1 本文实验所用工艺参数

参数	$L_{g}\left(\mathrm{nm} ight)$	$W_{g} (\mathrm{nm})$	$T_{ox}$ (nm)	$N_a (\times 10^{17}{\rm cm}^{-3})\;{\rm nmos/pmos}$	参数	$W_{\mathrm{int},l}(\mathrm{nm})$	$T_{\mathrm{int},l}(\mathrm{nm})$	$H_{\mathrm{ILD},l}\;(\mathrm{nm})$
$\mu$	60.0	150.000	2.500	1.00000/1.00000	$\mu$	150.0	500.0	300.00
$3\sigma$ (片间)	9.0	11.250	0.250	0.72750/0.72750	$\sqrt{3}\sigma$ (片间)	15.0	25.0	22.50
3σ (片内)	4.0	5.625	0.125	0.36375/0.36375	$\sqrt{3}\sigma$ (片内)	7.5	12.5	11.25

 $\cdot\sigma, \mu + \sqrt{3} \cdot \sigma$ ]; 将  $N_a$ 表示为泊松分布。各个参数的 均值和 3 倍/ $\sqrt{3}$  倍标准差取值如表 1 所示,其中  $\mu$  为 各个工艺参数的均值; 3 $\sigma$  (片间/片内)为工艺参数  $L_g, W_g 及 T_{ox}$ 的 3 倍片间/片内标准差;  $\sqrt{3}\sigma$  (片间/ 片内)为工艺参数  $W_{\text{int,l}}, T_{\text{int,l}} 及 H_{\text{ILD,l}}$ 的 $\sqrt{3}$  倍片间/ 片内标准差; nmos/pmos 为工艺参数  $N_a$ 对应 n/p型栅氧化管。

在分析工艺参数的空间关联性时,需要知道逻 辑门和互连线的物理位置信息,为此本文首先用 UCLA大学的开源布局工具 Capo<sup>16</sup>进行初始布局, 然后再执行全局布线。依据不同的电路单元数,本 文将芯片划分为不同数量的方格,使得每个方格内 的逻辑门或互连线段数量不超过 100 个。为简化分 析,本文忽略掉输入信号斜率、输出信号负载及路 径耦合噪声对延时模型的影响,从而将逻辑门和互 连线延时表示为工艺参数的二阶泰勒展开式。

为了验证空间关联 SSTA(CSSTA)的精确性, 本文基于相同的方格模型运行了蒙特卡洛仿真 (MC)。MC是 MinnSSTA 中的一段源代码程序,为 平衡精度和时间开销,本文设置了10000次迭代, 在每一次迭代时,程序首先随机选择一组工艺参数, 通过更新这组工艺参数对应的引脚电容, 计算时序 图上各条边的电阻电容参数(RC),来获得各条边的 延时; 然后再采用 PERT 拓扑方法, 通过传递延时 参数,以获得最终的路径总延时。MC的 10000次 迭代产生了 10000 个随机的路径延时结果, 通过统 计这些结果的最大值、最小值、平均值及方差信息, 即可得到仿真的统计信息。另外,在计算边的 RC 参数和延时变量时,本文使用到了矩阵分解,为此 MC 调用了 MTALAB 的数学计算源文件,限于篇 幅,具体细节不再赘述。表 2 为本文 CSSTA 和 MC 的对比结果,其中#C, #G分别为测试集中各个电 路对应的单元数和方格数。对于每个 ISCAS89 测试 电路,表中列出了两种方法对应的均值 u(ps),标准

差 sd(ps), 5%概率点 5%Pt 和 95%概率点 95%Pt  $(ps,5\%Pt 定义为存在一个延时值, 使得 <math>p(x \le 5\%Pt)$ = 5%; 95%Pt 定义为存在一个延时值, 使得  $p(x \le 95\%$ Pt) = 95%)及运行时间 t(s)。从表 2 可以 看出,两种方法的结果非常相近,均值、标准差、 5%Pt 及 95%Pt 的平均相对误差分别只有 0.81%, -0.72%, 2.23%及-0.05%。这表明本文 CSSTA 具有 相当高的精确度,足以匹配真实的延时分布。对于 电路 s38417, 图 5 给出了两种方法下的延时 PDF 和 CDF 对比结果,其中三角块线为考虑空间关联且 假设工艺参数同时服从高斯分布和非高斯分布的 CSSTA 结果, 方块线为相同方格模型下的 MC 结 果,从图中也可以看出,两种方法对应的曲线具有 较高的匹配度。另外,从表 2 也可以看出,虽然本 文 CSSTA 采用了 ICA 和 PCA 转换技术,但其运 行时间相对于 MC 仍要小很多,除了电路 s27 的运 行时间约为 MC 运行时间的 1.29%外,其它电路的 运行时间几乎为 MC 运行时间的千分之几;特别是 对于电路 s35932,本文 CSSTA 运行时间为 10.65 s, 而 MC 却需要超过 7 h。因此, 根据表 2 可以计算 出,本文9组电路的 CSSTA 平均运行时间约为 MC 平均运行时间的 0.21%。

为了验证 SSTA 非线性非高斯建模的合理性, 本文与文献[9]中的结果进行了比较,比较的对象为 相对 MC 的偏离误差。在文献[9]中,作者虽然也将 部分工艺参数假设为非高斯分布,但其延时依赖关 系却是线性的。表 3 给出了本文方法与文献[9]方法 的对比结果,表中没有列出运行时间结果,这是因 为:(1)表 3 关注的重点是两种方法的精确程度;(2) 两种方法的运行时间相对 MC 都要小很多。从表 3 可以看出,若以 MC 为比较基准,本文方法的均值、 标准差、5%Pt 及 95%Pt 的平均相对误差更小,这 表明本文方法相比文献[9]更为精确。

表 2 本文空间关联 SSTA(CSSTA)方法与蒙特卡洛(Monte Carlo, MC)仿真的对比结果

测试集		CSSTA					MC					(CSSTA - MC) / MC (%)				
电路 名称	#C	#G	u(ps)	$\rm sd(ps)$	5%Pt (ps)	95%Pt (ps)	t(s)	u(ps)	$\mathrm{sd}(\mathrm{ps})$	5%Pt (ps)	95%Pt (ps)	t(s)	u	sd	5% Pt	95%Pt
s27	13	4	89.4	8.5	63.9	114.9	0.03	89.7	8.5	64.2	115.2	2.32	-0.33	0	-0.47	-0.26
s1196	547	16	434.3	40.8	311.9	556.7	0.09	436.2	40.7	314.1	558.3	153.23	-0.44	0.25	-0.70	-0.29
s5378	2958	64	363.5	33.3	263.6	463.4	0.43	362.9	34.3	260.1	465.8	623.75	0.17	-2.92	1.35	-0.52
s9234	5825	64	596.2	55.2	430.6	761.8	0.78	594.1	57.1	422.8	765.4	1282.61	0.35	-3.33	1.84	-0.47
s13207	8260	256	1072.8	104.2	760.2	1385.4	1.98	1065.7	105.2	750.1	1381.3	1976.78	0.67	-0.95	1.35	0.30
s15850	10369	256	1210.2	114.1	867.9	1552.5	1.39	1204.3	117.5	851.8	1556.8	2284.83	0.49	-2.89	1.89	-0.28
s35932	17793	256	1059.7	91.8	784.3	1335.1	10.65	1037.9	100.7	735.8	1340.1	26250.71	2.10	8.84	6.60	-0.37
s38417	23815	256	873.4	85.1	618.1	1128.7	4.04	856.1	86.8	595.7	1116.5	5175.38	2.02	-1.96	3.76	1.09
s38584	20705	256	1530.5	137.9	1116.8	1944.2	5.15	1497.1	142.9	1068.4	1925.8	6004.48	2.23	-3.50	4.53	0.96
	平均值		-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	0.81	-0.72	2.23	-0.05



图 5 电路 s38417 在空间关联 SSTA 与 MC 方法下的延时 PDF, CDF 对比结果

测试集 本文 (CSSTA-MC)/MC (%) 文献[9] (SSTA - MC)/MC (%) 电路名称 #C #G 5%Pt(ps) 95% Ps(ps)5%Pt(ps) 95% Ps(ps)u(ps)sd(ps)u(ps)sd(ps)s2713 4 -0.330 -0.47-0.260.130.220.570.13s119654716-0.440.25-0.70-0.290.290.590.830.97s53782958 640.17-2.921.35-0.52-0.53-1.32 -1.56-1.34582564 0.35-3.33 1.84-0.470.91 1.81 -1.31 1.29s9234s132078260 2560.67-0.951.35-0.301.772.24 3.032.39s15850103692560.49-2.891.89-0.281.982.513.793.14177932562.108.84 6.60 -0.371.153.673.78s359322.8223815 2562.02-1.96 3.76 1.71 3.29 3.87 3.59s38417 1.10 s3858420705 2562.23-3.504.530.96 1.513.68 3.613.50平均值 0.81-0.722.240.051.11 2.052.472.24

表 3 本文空间关联 SSTA 方法与文献[9]方法的对比结果

# 6 结束语

本文提出了一种考虑空间关联工艺偏差的统计 静态时序分析方法。该方法首先分析了芯片内不同 位置工艺参数之间的空间关联性,并提出了一种考 虑非高斯分布工艺参数的二阶延时模型;然后通过 执行非线性非高斯延时表达式的求和、求极大值操 作,实现了延时变量的 PDF 评估。ISCAS89 实验 结果验证了本文 SSTA 方法的准确性和快速性。

## 参考文献

- Tang Q, Rodriguez J, Zjajo A, et al. Statistical transistorlevel timing analysis using a direct random differential equation solver[J]. *IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems*, 2014, 33(2): 210–223.
- [2] Shi B and Srivastava A. Thermal stress aware 3D-IC statistical static timing analysis[C]. Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Great Lakes Symposium on VLSI, Paris, France, 2013: 281–286.
- [3] Li B, Chen N, Xu Y, et al. On timing model extraction and hierarchical statistical timing analysis[J]. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 2013, 32(3): 367–380.
- [4] Zhang Xiao-lin, Ye Jing, Hu Yu, et al.. Capturing post-silicon

variation by layout-aware path-delay testing[C]. Proceedings of IEEE/EDAA Design, Automation & Test in Europe, Grenoble, France, 2013: 288–291.

- [5] Wagner M and Wunderlich H. Efficient variation-aware statistical dynamic timing analysis for delay test applications
   [C]. Proceedings of IEEE/EDAA Design, Automation & Test in Europe, Grenoble, France, 2013: 276–281.
- [6] Amin C, Menezes N, Killpack K, et al. Statistical static timing analysis: how simple can we get?[C]. Proceedings of IEEE/ACM Design Automation Conference, San Diego, USA, 2005: 652–657.
- [7] Chang H and Sapatnekar S. Statistical timing analysis considering spatial correlations using a single PERT-like traversal[C]. Proceedings of IEEE/ACM International Conference on Computer Aided Design, San Jose, USA, 2003: 621–625.
- [8] Zhan Y, Strojwas A, Li X, et al.. Correlation-aware statistical timing analysis with non-Gaussian delay distributions[C]. Proceedings of IEEE/ACM Design Automation Conference, San Diego, USA, 2005: 77–82.
- [9] Singh J and Sapatnekar S. A scalable statistical static timing analyzer incorporating correlated non-Gaussian and Gaussian parameter variations[J]. *IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems*, 2008, 27(1): 160–173.
- [10] Kirkpatrick T and Clark N. PERT as an aid to logic design[J]. IBM Journal of Research and Development, 1966, 10(2):

135 - 141.

- [11] Morrison D. Multivariate Statistical Methods[M]. 2nd Edition, New York: McGraw-Hill, 1976: 170–179.
- [12] Tony B. An ICA page-papers, code, demos and links[OL]. http://cnl.salk.edu/~tony/ica.html. 1996.11.
- [13] Li X, Le J, Gopalakrishnan P, et al. Asymptotic probability extraction for non-normal distributions of circuit performance[C]. Proceedings of IEEE/ACM International Conference on Computer Aided Design, San Jose, USA, 2004: 2–9.
- [14] Brglez F, Bryan D, and Kozminski K. Combinational profiles of sequential benchmark circuits[C]. Proceeding of IEEE International Symposium on Circuits and Systems, Portland, USA, 1989: 1929–1943.
- [15] Juha K. Independent component analysis and blind source separation[OL]. http://research.ics.aalto.fi/ica/fastica/. 2011.
   2.

- [16] Andrew C. Wire length-driven standard-cell placement[OL]. http://vlsicad.ucsd.edu/GSRC/bookshelf/Slots/Placement/. 2000.6.
- 喻 伟: 男,1986年生,博士生,研究方向为大规模集成电路设 计自动化技术.
- 杨海钢: 男,1960年生,研究员,博士生导师,研究方向为高速 可编程逻辑芯片设计技术、数模混合信号 SOC 设计技术.
- 刘 洋: 男,1983年生,博士,助理研究员,研究方向为大规模 集成电路设计自动化技术.
- 黄 娟: 女,1983 年生,博士,助理研究员,研究方向为大规模 集成电路设计自动化技术.
- 蔡博睿: 男,1988年生,研究实习员,研究方向为大规模集成电路设计自动化技术.
- 陈 锐: 男,1986年生,博士生,研究方向为粗粒度可重构阵列 结构方面的研究.

# 中国电子学会电路与系统分会第26届学术年会征文通知

中国电子学会第26届电路与系统学术年会将于2015年10月在湖南长沙召开。会议由中国电子学会电路与系统分会主办,中国科学院电子学研究所和湖南大学承办。我们真诚地邀请电路与系统及相关领域的科研工作者莅临本次年会!现将会议有关事项通知如下:

一.征文范围

本次年会诚征有关电路与系统及相关领域最新研究进展的学术论文(中英文均可)。征文方向主要包括 (但不限于):电路与系统理论与技术;大规模集成电路设计与制造技术;传感器、无线传感网和物联网;信 号与信息处理系统;音频、视频、3D视频系统技术;神经网络、图论与系统优化;非传统电路与系统。

#### 二. 征文要求

来稿必须是未曾在国内外公开发表过的文章,无弄虚作假,无一稿多投,不得涉及国家秘密。以正式 论文的形式书写应征论文。中文论文请包括英文题目、作者、作者单位、摘要和关键词;英文论文请附上 中文题目、作者、作者单位、摘要和关键词。

#### 三.论文提交

采用中科院国际会议服务平台 http://cscas26.csp.escience.cn/dct/page/1 投稿。登录网站后请先注册, 后投稿。也可以通过邮箱 cscas@mail.ie.ac.cn 进行投稿。

**重要日期**:提交论文截止日期:2015 年 7 月 15 日;通知论文接收日期:2015 年 8 月 15 日;提交论文 修改稿日期:2015 年 9 月 15 日。

#### 联系方式:

湖南大学信息科学与工程学院 邮编: 410082

联系人: 王春华, 孙晶茹 联系电话: (0731) 88821970

中国科学院电子学研究所 邮编: 100190

联系人:刘团结,陈倩,李娜,张燕 联系电话: (010) 58887066

#### 四. 论文评奖

对到会交流的论文进行优秀论文评选并颁发优秀论文证书,同时推荐到《电子与信息学报》、《雷达学报》、《电子学报》、《计算机学报》、《太赫兹科学与电子信息学报》、《系统工程理论与实践》、《Journal of Electronic Science and Technology》评审发表。